

(お願い) 学外利用による研究成果の取り扱いについて

東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構
コアファシリティセンター

平素よりお世話になっております。この度はコアファシリティセンター（CFC）をご利用くださり、誠にありがとうございました。

本学は、学外利用を積極的に推進することで、科学と技術の水準を高め、もって文化の進展に寄与し、我が国および世界の平和と発展に貢献することを使命としております。

つきましては、以下学外利用による研究成果の取り扱いにご賛同くださり、引き続き CFC の活動をご支援くださりますようお願い申し上げます。

1. 学会発表・学術論文における謝辞を記載する場合

本利用によって得られた研究成果を学会発表や学術論文として発表する場合には以下の 1) 及び 2) をご参照の上、謝辞の記載をお願いいたします。

1) コアファシリティ構築支援プログラムに関する謝辞記載

本利用は、先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）の支援を受けておりますので、以下の例を参考に謝辞において課題番号を表示くださりますようお願いいたします。

(例)

【和文の場合】

本研究は文部科学省先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）JPMXS0440200024 で共用された機器を利用した成果です。

【英文の場合】

This work was the result of using research equipment shared in MEXT Project for promoting public utilization of advanced research infrastructure (Program for supporting construction of core facilities) Grant Number JPMXS0440200024.

*1 課題番号の下 2 桁（JPMXS0440200024）は設備を利用した年（西暦）の下 2 桁（例では 2024 年の利用を示します）となりますので、記載にはご注意ください。

2) 技術支援・設備利用に対する謝辞記載

また、本利用により得られたデータを用いて学会や学術論文にて発表する場合は、以下の例を参考に利用に関連した部門等への謝辞を表示くださりますようお願いいたします。

(例)

The authors thank the [部門等名称（英語） *2], Institute of Science Tokyo for XXXXX analysis (for technical assistance).

***2 部門等名称（英語）** は以下のとおりです。

部門等名称（日本語）	部門等名称（英語）
設計製作部門	Design and Manufacturing Division
分析部門	Materials Analysis Division
マイクロプロセス部門	Semiconductor and MEMS Processing Division
ファシリティステーション部門	Facility Station Division

2. 学会発表の協働発表者・学術論文の共著者として CFC 職員を追加する場合

共著者として加える CFC 職員の同意の上、下記 CFC 総務部門にその旨ご連絡ください。

3. 知的財産（特許等）に関する出願を行う場合

下記規程のとおり、本利用によって発生する知的財産権は原則として利用者に帰属いたしますが、本利用の内容によっては出願に関する権利（特許を受ける権利等）が大学にも発生する場合がありますので、CFC 総務部門にその旨をご連絡ください。

（参考：東京科学大学リサーチインフラ・マネジメント機構コアファシリティセンター共用設備等の利用に関する要項）
第9条 利用者が共用設備等を利用したことにより得られた知的財産権は、原則として利用者に帰属するものとする。ただし、センター職員による技術支援等を受けた場合又は当該知的財産権が共用設備等若しくはセンターが予め用意した操作、運転等の方法に係るものである場合には、利用者は、センターと当該知的財産権の帰属について、協議するものとする。

関連規程等

<https://www.ofc.titech.ac.jp/off-campus/学外利用/>

（本件に関するお問い合わせ）

東京科学大学 リサーチインフラ・マネジメント機構
コアファシリティセンター 総務部門
reception-gakugai@ofc.titech.ac.jp